

中国版「知的財産活動調査」からみる中国の知財政策動向

2020年4月16日

JETRO 香港事務所

2020年3月、中国国家知識産権局から、「2019年中国専利調査報告¹」が公表された。この報告は、中国版「知的財産活動調査²」に相当するものであり、2008年から毎年実施され、中国において有効な専利（特許、実用新案、意匠）を有する企業、大学、研究機関、個人を対象としたアンケート調査により、中国での知財活動の実態や今後の動向、政策上の課題を見出そうとするものである。本稿では、当該報告の概要を紹介する。

1. 調査対象

2018年末において有効な専利を有する企業、大学、研究機関、個人を対象とし、100件以上の権利者全て及び100件未満の権利者はランダムでサンプリングしている。有効回答数及び回収率は以下の通り。

企業 10578 社 (99.8%)、大学 660 校 (92.6%)、研究機関 301 機関 (78.4%)、個人 1246 名 (69.2%)、合計 12785 者 (94.7%)

2. 調査結果の概要

調査は、専利創造、専利活用、専利保護、知財管理、知財サービス、国家知財戦略の実施の6点についてアンケートが実施されている。以下、主な結果を示す（下線は筆者による強調表示）。

（1）専利の創造について

- ・研究開発費用のリソース（選択肢は複数選択可）について、企業では「企業資金」が 90.2%、次いで「政府資金」9.0%であり、大学・研究機関（以下、大学等）では「地方自治体プロジェクト」が 62.3%、「企業委託」が 38.5%、「国家プロジェクト」が 33.8%であった。
- ・研究開発期間について、発明専利となる成果については1～2年が 39.2%と最

¹ 原文 URL : <http://www.cnipa.gov.cn/docs/20200309165140567125.pdf>

² 日本国特許庁が実施している、企業等の知的財産活動の実態調査。

多である一方、実用新型専利では半年～1年が39.4%と最多、外観設計専利では半年～1年が最も多く37.5%、半年未満も30.9%となった。

- ・海外での研究開発活動について、95.7%の企業が海外では実施していないと回答。実施している企業の実施地域（複数選択可）としては欧州が46.8%、米国が42.6%、次いで日本が19.7%、その他が22.4%となった。また、海外で研究開発を行う理由（複数選択可）としては、海外の進んだ技術の修得が57.5%、海外の研究開発リソースの利用が45.2%である一方、自国技術の海外での活用についても44.3%と高い数値を示した。
- ・海外での専利出願（PCT含む）について、3.5%の企業が海外出願したと回答（図1）。昨年調査から1.4%増加した。

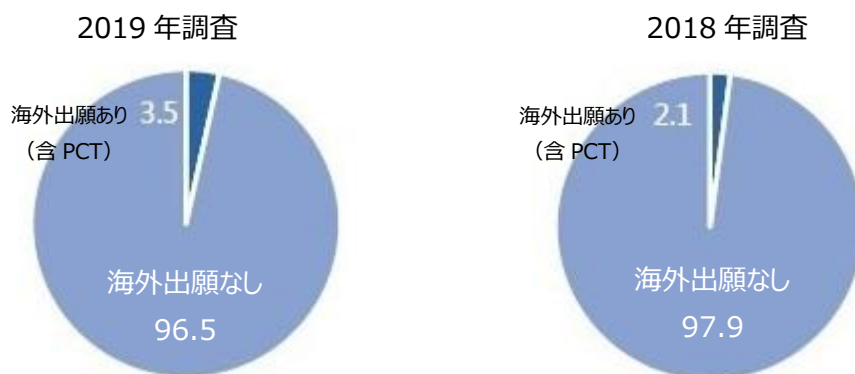


図1 海外での専利出願の有無 (%)

- ・出願している企業の出願先国・地域(複数選択可)は米国が64.3%、欧州が55.8%、日本が25.5%、その他が18.8%であった。また、今後海外出願を増強するとの回答は10.9%、維持が39.9%、減少が2.1%、不明が47.2%であった。
- ・大学等の専利出願について、大学の56.6%、研究機関の35.5%が、研究成果の10%未満しか専利出願していないと回答した。
- ・専利の品質への影響について、企業、大学、研究機関のいずれも「技術の研究開発レベル」が最も影響すると回答。一方、「専利代理人の質」や「専利審査の質」と回答した割合は大学が最も低くなった。

(2) 専利の活用について

- ・専利の実施率（自己実施やライセンス等で実施している件数を保有有効権利件数で割った値）について、専利全体では55.4%となり昨年より2.8%増加、発明専利では49.4%となり昨年より0.8%増加したが、全体の傾向としては、実施率は漸減傾向にある（図2）。

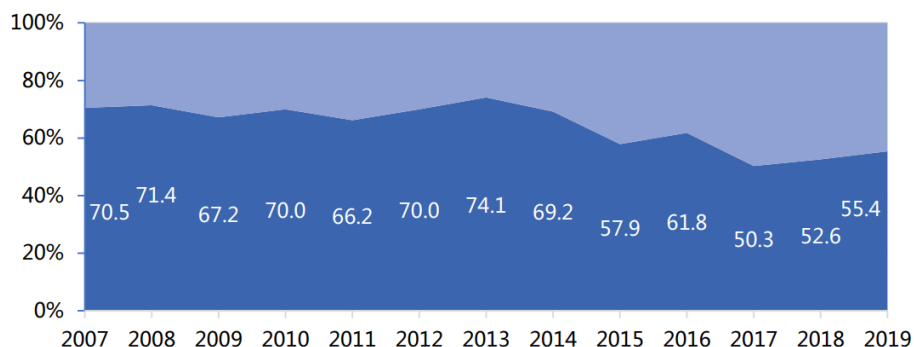


図2 専利の実施率推移 (%)

- ・実施率の各専利ごとの内訳について、発明専利では、企業 62.1%、大学 16.8%、研究機関 31.1%、全体では 49.4%、实用新型専利では、企業 63.3%、大学 10.7%、研究機関 46.0%、全体では 56.9%、外觀設計（意匠）専利では、企業 67.0%、大学 5.5%、研究機関 63.2%、全体では 57.4%となり、必ずしも発明専利の実施率が他の専利に比べて高いわけではない、また、大学の実施率が非常に低いという結果となった。
- ・専利の実施許諾率（ライセンスした専利権の割合）について、専利全体では 6.1% となり昨年より 0.6%増加したが、全体の傾向としては、漸減傾向にある（図3）。

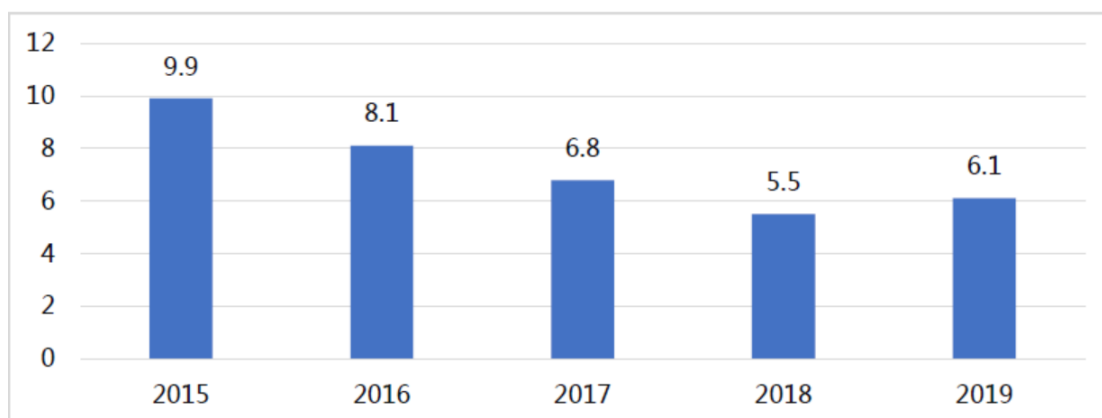


図3 専利の実施許諾率推移 (%)

- ・未実施専利の機能（複数回答可）について、企業では「技術の蓄積のため」が最も高く 80.1%、次いで「印象形成・宣伝効果のため」42.1%、「競合他社に対する権利侵害申立のため」21.7%、「競合他社の抑制・封じ込めのため」20.3%となった一方、大学では「技術の蓄積のため」63.9%に次いで「評価指標のため」が 56.3%、「奨励獲得のため」が 41.6%となり、権利取得の目的が大きく異なる結果となった。
- ・実施済み専利による収益状況について、発明専利では 500 万円（約 7,700 万円）以上が最も多いのに対し、实用新型では 10～50 万円（約 154～770 万円）が最多、外觀設計専利では 5 万円（約 77 万円）未満が最多となった（表1）。

表1 実施済み専利の収益状況 (%)

	発明専利	実用新型	外観設計	全体
500 万元以上	15.4	9.2	8.9	11.9
100 万～500 万元 (500 万元含まず)	14.0	11.8	10.5	12.5
50 万～100 万元 (100 万元含まず)	15.7	16.7	14.2	15.6
10 万～50 万元 (50 万元含まず)	15.5	19.6	16.4	16.9
5 万～10 万元 (10 万元含まず)	7.5	10.7	11.4	9.5
5 万元以下 (5 万元含まず)	4.8	8.8	12.1	7.9
収益はない	2.3	2.7	2.8	2.5
収益はあるが、よく分からない	24.8	20.5	23.8	23.3
合計	100.0	100.0	100.0	100.0

- ・ 専利実施許諾届出制度 (専利実施許可合同备案管理办法) について、制度を知らないために登録していないという回答が最も多く (44.1%)、次いで秘密保持のためが 17.0% を占め、効力が不明確 (12.4%) との回答もあった。中国では通常実施権についても政府への登録が義務付けられているが、周知不足などの理由から登録されないケースがあることがわかる。
- ・ 海外への専利技術のライセンス及び移転について、企業の 0.7% が外国企業等へのライセンス・移転をした経験があると回答。一方、外国企業等の専利を使用したことがあると回答した企業は 1.5% であった。
- ・ 海外との専利技術取引について、欧州、米国、日本が主な取引対象であるとの結果となった (図 4)。

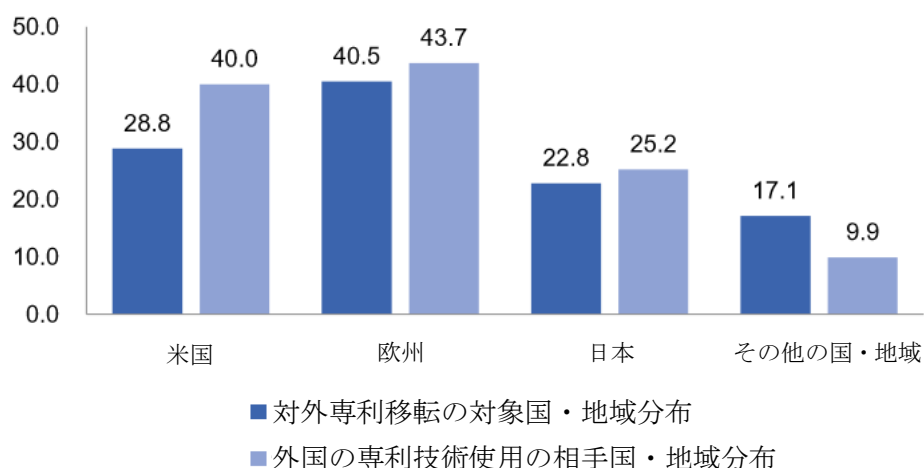


図 4 中国の企業専利権者の国際専利の主要取引国・地域分布 (単位: %)

- ・ 専利技術の導入について難度が高い分野としては、「材料技術」及び「コンピュータ・通信・電子技術」の 2 分野が突出する回答であった。

(3) 専利の保護について

- ・中国の知財保護について「着実に強化すべき」とした回答は昨年調査から 11.2% 減って 54.0% となり、「適切な水準である」とした回答は 10.2% 増加して 23.6% となり、中国の知財保護水準への満足度はこの 1、2 年で向上している（表 2）。

表 2 中国の知財保護水準に対する評価（%）

	2014	2015	2016	2017	2018	2019
保護ニーズは切実で大幅に強化する必要あり	23.5	24.4	18.3	24.5	17	19.1
着実に強化する必要あり	63.9	67	68.8	63.7	65.2	54.0
現在の水準は適切である水準は適切	10.4	7.2	10.4	7.9	13.4	23.6
保護が過度に厳格で適宜緩和する必要あり	2.2	1.3	2.5	3.9	4.4	3.4
合計	100	100	100	100	100	100

- ・専利保護の制約について、「専利出願（手続）の期間が長く技術発展の速度に追いつかない」とする回答が最も多く 62.2% となり、昨年比でも 6.5% 増加した。一方、「専利保護の効果が良くなく安定性が悪い」とする回答は 29.2% となり昨年比では 8.7% 減少した。
- ・専利権侵害に遭遇したことがあると回答した専利権者は昨年調査から 2.7% 増加して 13.3% となった。また、専利権侵害訴訟に関わったと回答した専利権者は昨年調査から 2.1% 増加して 4.2% となった。全体としては漸減傾向にあったが、近年小幅ながら上昇している（図 5）。

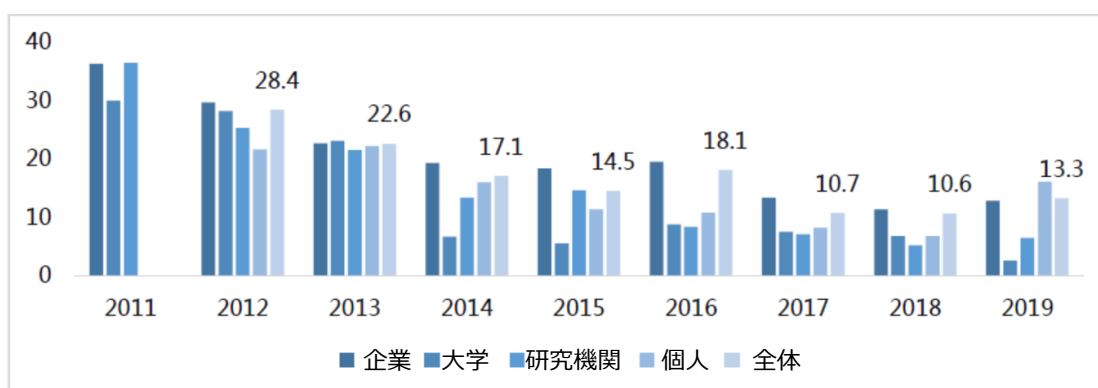


図 5 専利権侵害に遭遇した専利権者の割合（%）

- ・専利権侵害に遭遇した際にとる対策（複数選択可）として、「自ら侵害者側と協議して解決する」が最多の 36.8% となり、昨年調査で最多であった「侵害停止を求める弁護士書簡を送付する」（34.8%）より多くなった。「訴訟の提起」は 27.1%、「行政執行の申請」は 19.9% であった。

- ・権利保護への要望として、訴訟よりも行政による取り締まりの強化を求める回答が多い結果となった。
- ・裁判所が決定した賠償金額または法廷審問で定めた和解金額について、全体では10～50万円（約154～770万円）が29.4%と最多、次いで10万円未満（約154万円未満）となった。また、賠償なしとする割合は26.8%であった。全体的な傾向としては賠償金額・和解金額は上昇する傾向にある（表3）。

表3 裁判所が決定した賠償金額または法廷審問で定めた和解金額（%）

	2014	2015	2016	2017	2018	2019
10万円以下（10万円含まず）	51.3	21.7	28.9	34.7	43.3	27.8
10万円～50万円（50万円含まず）	34.3	23.9	18.8	13.4	11.7	29.4
50万円～100万円（100万円含まず）	11.5	6.0	3.8	15.3	10.7	10.1
100万円～500万円（500万円含まず）	2.6	1.1	1.7	10.7	3.0	3.6
500万円以上	0.3	1.8	0.1	0.4	2.4	2.4
賠償金なし	-	45.5	46.7	25.5	28.9	26.8
合計	100	100	100	100	100	100

- ・専利権に濫用に遭遇した経験について、専利権者の3.8%が遭遇したことがあると回答した。権利濫用の行為（複数回答可）としては、「実用新型専利や外観設計専利を利用して、随意に訴訟を提起し、訴訟前の侵害停止命令などの臨時措置を軽率に使用する」が最多となった（図6）。

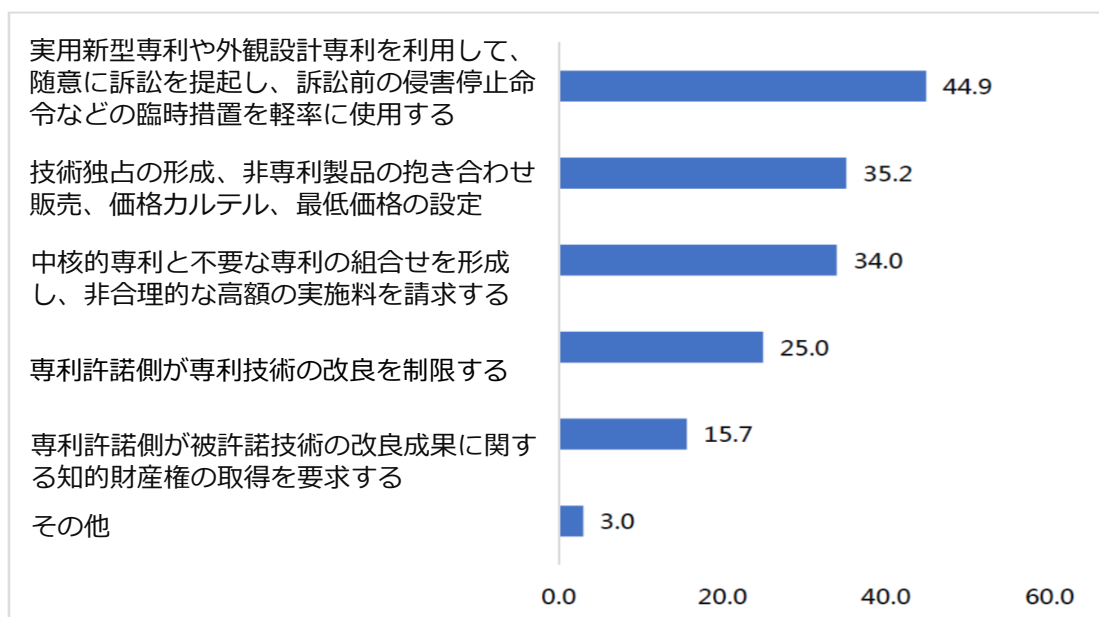


図6 専利権の濫用に関する行為（複数選択可）（%）

- ・ 専利権の無効審判手続きへの評価について、専利権侵害遭遇経験のある者の方が
ない者と比べて「訴訟による紛争解決の効率を高めている」と回答する率が高い。
- ・ 専利制度の改善への要望について、選択肢とされた部分意匠の導入など3点は、
いずれも高い水準となった（表4）。

表4 知財関連制度の整備に対する専利権者の要望（複数選択可）（%）

	企業	大学	研究機関	個人	全体
部分意匠に意匠保護を提供する	86.9	83.7	<u>90.7</u>	88.3	87.2
編集、偽造、盗用などの行為による専利出願に対して専利権を授与しない	92.5	94.1	<u>99.5</u>	91.6	92.4
専利権付与の質を保証するために、明らかに付与してはならない専利権については、 <u>国務院専利行政部門が権利付与の決定に対する訂正、再審査を行うことを望む</u>	94.5	<u>99.1</u>	97.0	93.5	94.4

（4）知財管理について

①企業

- ・ 「知財管理部門を設置している」と回答した企業の割合は昨年調査から 3.6%増加して 34.7%となった。また、その構成人数は専属・兼任ともに2名以下が最も多く7割以上であった。
- ・ 専利譲渡・実施許諾収益のある企業における発明者等への奨励（複数回答可）について、「奨励目的の金銭的報酬」が 63.1%、「昇進への考慮」が 39.7%、「有給休暇の付与」が 15.1%がとなり、「奨励なし」とした企業は 14.2%であった。
- ・ 職務発明と報酬制度についての課題として、「企業内部の制度の制定過程における奨励の基準についての合意が難しい」とする回答が最多となった（図7）。

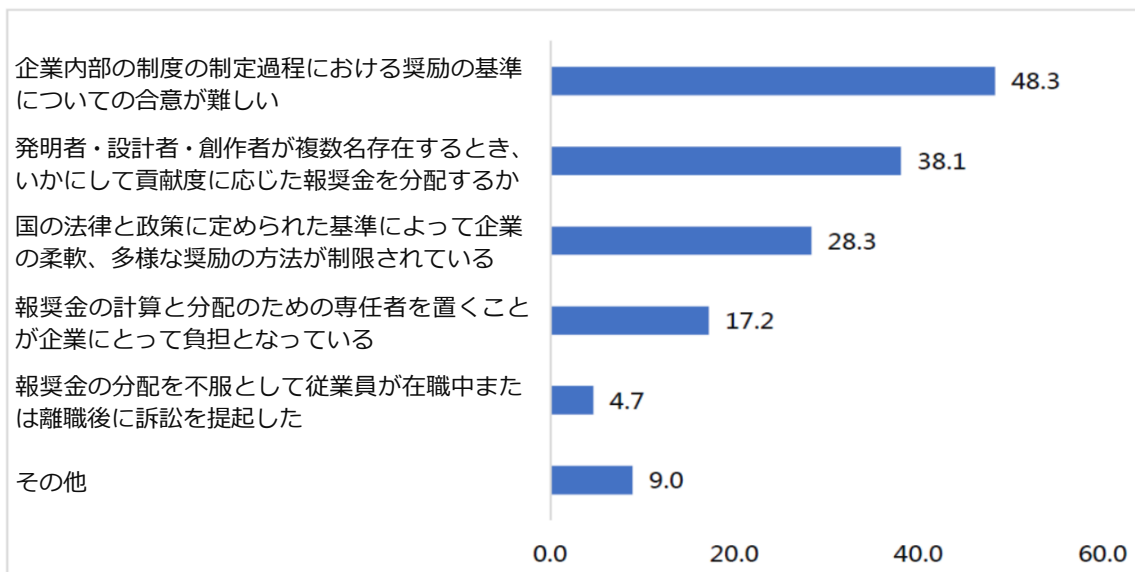


図7 職務発明と報酬制度の課題（複数選択可）（%）

- ・企業の知財政策ニーズとして、「政府特別資金の支援政策」を求める回答が最多となり、次いで「研究開発費・出願・維持費の控除」、「ライセンス・譲渡収入に関する税金免除」が続いた。

②大学・研究機関

- ・「知財管理部門を設置している」と回答した大学・研究機関の割合は60.8%（うち専門部署が13.5%、兼任部署が47.3%）であった。また、その構成人数は専属・兼任ともに2名以下が最も多く8割以上であった。
- ・知財移転・実用化を行う部門として、「知財管理部門が行う」とする大学・研究機関は53.6%、「学内の技術取引センターが行う」とする大学・研究機関は17.5%であり、知財移転実用化部門を設置している大学・研究機関は6.4%に留まった。
- ・知財権の帰属について、「申請者（発明者）の個人所有」とする大学・研究機関は12.5%、「申請者が所属する高等教育機関・研究機関所有」とする大学・研究機関は48.0%、「申請者と所属組織の共有」とする大学・研究機関は39.5%であった。
- ・大学・研究機関の知財政策ニーズとして、「政府特別資金の支援政策」を求める回答が最多となり、次いで「ライセンス・譲渡収入に関する税金免除」、「研究開発費・出願・維持費の控除」が続いた。

（5）知財サービスについて

- ・知財サービスの利用について、研究機関では「専利情報サービス」の利用が比較的高く、大学では「専利コンサルティングサービス」及び「専利教育サービス」の利用が高いという結果となった（表5）。

表5 各種知財サービスの利用状況（複数選択可）（%）

	企業	大学	研究機関	個人	全体
専利代理サービス	<u>90.6</u>	84.5	73.2	90.6	<u>90.5</u>
専利法律サービス	<u>13.6</u>	5.9	5.6	6.7	12.6
専利情報サービス	18.4	28.4	<u>42.4</u>	13.4	17.8
専利権商業化サービス	<u>4.8</u>	2.4	1.5	2.4	4.4
専利コンサルティングサービス	46.7	<u>55.2</u>	40.6	26.7	43.8
専利教育サービス	11.2	<u>26.2</u>	13.4	5.0	10.4
合計	185.3	202.6	176.8	144.7	179.5

- ・ 政府が提供する知財公共サービスに対する要望（複数回答可）として、「知財専門人材の育成」（68.1%）を求める回答が最多となり、次いで「専利価値評価」（61.5%）、「重点分野の知財動向分析」（47.7%）、「専利権者の開放ライセンス開示サービスの提供」（34.8%）が続く結果となった。

（6）国家知財戦略の実施について

- ・ 2008年の国家知的財産権戦略の実施以降、8割以上の専利権者が、中国の知財の発展レベルが「上昇した」と回答した（図8）。

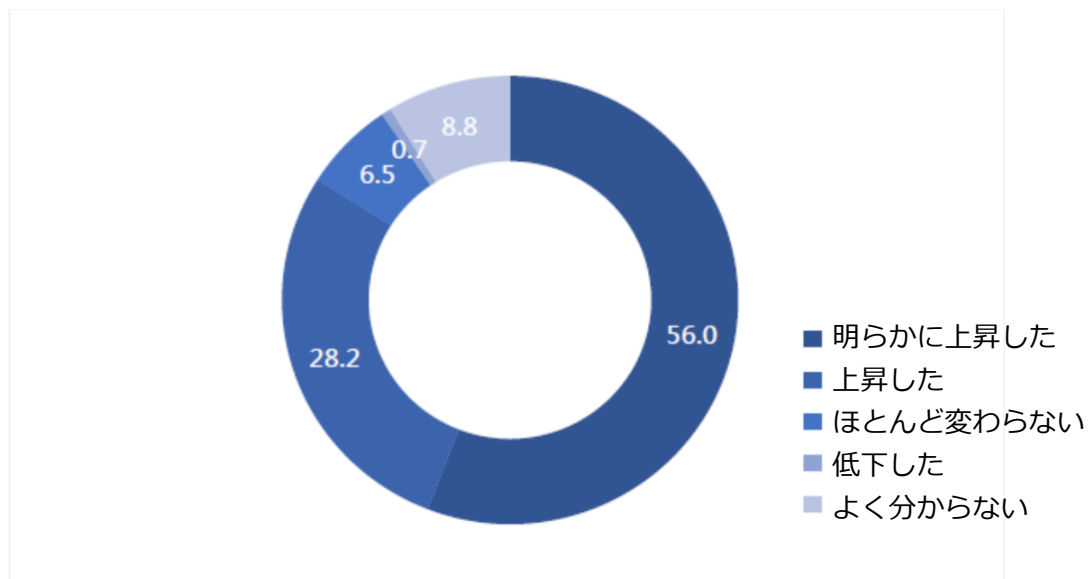


図8 専利権者における中国の知財の発展レベルに対する認識 (%)

3. 解説

この調査は、中国政府における知財政策の基礎資料とされるものであることから、設定されたアンケート項目や選択肢は、中国政府の課題認識及び政策動向が反映されているものと推察できる。

例えば、海外出願や海外との専利取引に関する項目からは、中国企業の知財面での海外展開が不十分であり、政策的に支援する方向性が読み取れる。特に、技術導入に関する設問からは、材料技術や通信技術の導入に課題を抱えており、本文中の「企業取材では、企業の中には、チップやハイエンド原材料などの専利技術の導入時に、技術面で世界をリードする企業がその技術的優位性と中核的専利を利用して、競争制限的な行為より専利技術の譲受側に制限を課す状況があることを示す企業もあった。例えば、譲渡側はその専利権に対し、譲受側が無効審判を請求することを許可せず、すなわち、譲受側が知的財産権の有効性に対して異議を申し立てることを禁じる状況が存在する。」との記載からも、材料及び通信、特に半導体チップ関連での技術導入が

大きな課題となっていることが示唆されている。

また、権利濫用に関する複数の選択肢からは、規制を強化すべきとする態様が示されている可能性がある。例えば、「技術独占の形成、非専利製品の抱き合わせ販売、価格カルテル、最低価格の設定」及び「中核的専利と不要な専利の組合せを形成し、非合理的な高額の実施料を請求する」などは、通信等の標準必須特許などにおいて競争法との関係で問題となる課題が選択肢として示され、また、「専利許諾側が専利技術の改良を制限する」及び「専利許諾側が被許諾技術の改良成果に関する知的財産権の取得を要求する」（いわゆるアサインバック）などは、技術移転においてライセンシーの立場から問題視される項目が選択肢とされている。

制度改正についての設問はより具体的であり、部分意匠の導入、冒認・悪意の専利出願への対応、訂正審判の導入を引き続き検討中であることが明らかである。冒認・悪意の専利出願に関しては、上記権利濫用に関する設問において、実用新型専利及び外観設計専利による権利濫用が選択肢とされている点についても着目される。

行政執行に関する項目は、司法ルートと行政執行ルートが併存する中国において、行政と司法とのせめぎあいの中、アンケート実施官庁である CNIPA として行政執行を強化する根拠とする思惑が、また、無効審判に関する項目についても司法との関係において侵害訴訟における無効の抗弁については無効審判が活用されるべきとする思惑が透けて見える。

知財活用に関する項目からは、特に大学等の知財活用が十分に進んでいないこと、これを解決する方向性の一つとして、組織と発明者の権利帰属に着目していることがわかる。また、政府の支援策への要望の選択肢として、「ライセンス・譲渡収入に関する税金免除」、つまりパテントボックス税制の導入を検討していることを示唆する項目が設定されていることも注目される。

全体として、中国における知財保護についての制度ユーザーの満足度がここ1、2年で上昇する結果を示したことは、米中対立をはじめとする知財保護に対する指摘に対する反論材料の一つとして利用されるものと考えられる。

(以上)

文責：JETRO 香港 松本要